# Tesi di Laurea

### Matteo Dalle Vedove

## 17 giugno 2021

# Indice

1	Introduzione all'approccio SPICE				
	1.1	Parametri di simulazione			
2	Porte logiche in tecnologia c-MOS				
	2.1	NOT gate			
	2.2	AND gate			
	2.3	OR gate			
	2.4	NOR gate			
	2.5	NAND gate			
3	Elementi di memoria				
	3.1	SR latch			
	3.2	RAM dinamica			
	3.3	RAM statica			
4	Circuiti logici				
	4.1	Sommatore			
	4.2	Moltiplicatore			
5	Bib	liografia e sitografia			

#### Introduzione

Spesso nell'utilizzo comune di dispositivi digitali si da per scontato il funzionamento intrinseco degli stessi, pensando che il computer ragiona solo con valori binari  $\theta$  ed 1, tensione alta e tensione bassa. Spesso si dimentica però che, come ogni oggetto, anche i componenti che costituiscono i nostri device tecnologici sono, in origine, dei componenti analogici.

Lo scopo di questo documento è dunque quello di studiare come dei dispositivi analogici, in particolari i  $transistor\ MOS$ , possono essere utilizzati in ambito digitale, evidenziandone dunque i limiti fisici e dinamici legati alla loro implementazione. L'obiettivo sarà dunque quello di descrivere i principali circuiti che sono posti alla base di ogni calcolatore digitale, come le porte logiche, fino ad arrivare all'analisi di circuiti come il sommatore e moltiplicatore binario in tecnologia c-MOS.

 $L'approccio \ utilizzato \ per \ analizzare \ il \ problema \ sarà \ più \ di \ tipo \ simulativo \ utilizzando \ il software freeware \ LTspice \ [1] \ supportato \ dal \ fornitore \ di \ componentistica \ elettronica \ Analog \ Devices \ .$ 

### 1 Introduzione all'approccio SPICE

A livello accademico è stato descritto il principio di funzionamento dei MOSFET, ossia dei transistor che utilizzano l'effetto di carico che si instaura tra uno substrato semiconduttivo e un metallo ossidato per movimentare delle cariche elettriche. In base al drogaggio dei terminali di source e drain, complementare a quello di bulk, è possibile suddividere i transitori in due famiglie: gli n-MOS (drogaggio di tipo n) e i p-MOS (drogaggio di tipo p). In particolare la relazione statica che lega la corrente che scorre tra i terminali di drain e source è funzione sia della differenza di tensione  $V_{gs}$  tra gate e source, ma anche alla differenza di tensione  $V_{ds}$  tra drain e source:

$$I = K_n \frac{W}{L} \left[ (V_{gs} - V_{tn}) V_{ds} - \frac{V_{ds}^2}{2} \right]$$
 (1)

In questa relazione è possibile osservare la presenza di 3 parametri fondamentali a determinare il comportamento del transistor: la conducibilità intrinseca  $K_n$ , proprietà caratteristica del semiconduttore utilizzato per il bulk, e le dimensioni caratteristiche W (larghezza) e L (lunghezza) del canale conduttivo. Nella caratteristica statica fondamentale è anche la tensione di soglia  $V_{tn}$  dipendente sia dalla costituzione del transistor, sia dalla differenza di tensione  $V_{bs}$  tra bulk e source.

Il modello presentato in equazione 1 è in realtà una versione approssimata della caratteristica di trasferimento reale di un transistor MOS e trascura molti fenomeni elettro-magnetici che nella realtà dovrebbero essere considerati; esso può essere utile a livello didattico per concepire il funzionamento di alcuni circuiti semplici, tuttavia per problemi più complessi un approccio analitico approssimato può portare a risultati fuorvianti.

Un approccio simulativo è infatti più indicato per poter analizzare le prestazioni di circuiti più complessi in quanto a prova di errori (una volta che ci si è assicurati di aver implementato correttamente gli schematici) e permette di considerare effetti elettro-magnetici che analiticamente sarebbe difficile da studiare.

In ambito elettronico per effettuare delle simulazioni numeriche di circuiti si utilizzano i software cosiddetti SPICE (acronimo di Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis); in particolare tra le numerose soluzioni disponibili sul mercato nel proseguimento del seguente testo si farà riferimento a LTspice XVII [1], software gratuito attualmente mantenuto dal produttore Analog Devices, aggiornato alla versione 17.0.27.0.

#### 1.1 Parametri di simulazione

Per poter effettuare delle simulazioni è necessario fornire al software una raccolta con le informazioni da utilizzare per modellare il transistor, ossia è necessario specificare tutti i parametri che possono essere sia geometrici, ma anche legati alle proprietà dei materiali.

Facendo diretto riferimento ai parametri presenti nell'equazione 1 per un transistor è necessario in primo luogo indicare la conducibilità intrinseca Kp  $[A/V^2]$ , la lunghezza L [m] e la larghezza W [m] del canale conduttivo. Altri parametri geometrici che possono essere utilizzati per migliorare l'analisi è indicare sia perimetro che area per il terminale di drain (parametri PD [m] e AD  $[m^2]$ ) e il terminale source (parametri PS e AS).

Come parametri funzionali per il calcolo della caratteristica statica dei MOSFET si menziona la tensione di soglia, modellata tramite il parametro Vto [V]. L'effetto body, dovuto alla differenza di tensione tra bulk e source, richiede invece di specificare il relativo coefficiente Gamma  $[V^{0.5}]$  e il coefficiente superficiale Phi [V]. Come ultimo parametro di un transistor si menziona il coefficiente di modulazione di lunghezza di canale Lambda  $[V^{-1}]$ .

Un componente reale, in condizioni statiche, presenta delle perdite di corrente sia tra drain e source, sia tra gate e source; analizzando invece il comportamento dinamico del circuito è possibile osservare che i MOSFET presentano un'inerzia alla trasmissione di carica (rispetto ad ogni coppia di terminali): tali effetti dunque possono essere modellati tramite una capacità equivalente. Questi parametri tuttavia non sono costanti ma sono descritti da relazioni fortemente non lineari, per questo non è possibile introdurre dei coefficienti nel simulatore ma ogni produttore, per garantire il segreto professionale, rende a disposizione dell'utenza un apposito modello SPICE dei componenti che tiene in considerazione, con una buona approssimazione, tutte le dispersioni e rallentamenti dei transistor.

		famiglia di transistor	
parametro	$\operatorname{unit} \grave{\mathrm{a}}$	n-MOS	p-MOS
K	$[A/V^2]$	$50 \cdot 10^{-6}$	$20 \cdot 10^{-6}$
W	[m]	$50 \cdot 10^{-6}$	$20 \cdot 10^{-6}$
L	[m]	$50 \cdot 10^{-6}$	$20 \cdot 10^{-6}$

Tabella 1: parametri di simulazioni utilizzati nel seguente documenti; i dati sono basati su transistor ALTRE INFORMAZIONI

- 2 Porte logiche in tecnologia c-MOS
- 2.1 NOT gate
- 2.2 AND gate
- 2.3 OR gate
- 2.4 NOR gate
- 2.5 NAND gate

- 3 Elementi di memoria
- 3.1 SR latch
- 3.2 RAM dinamica
- 3.3 RAM statica

- 4 Circuiti logici
- 4.1 Sommatore
- 4.2 Moltiplicatore

## 5 Bibliografia e sitografia

 $[1] \quad \text{Analog Devices. } \textit{LTspice.} \quad \text{URL: https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html.}$